(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-162625 (P2000-162625A)

(43)公開日 平成12年6月16日(2000.6.16)

(51) Int.Cl.7		識別記号	٠	FΙ			テーマコート*(参考)
G02F	1/1343			G 0 2 F	1/1343		2H091
	1/1335	520			1/1335	520	2H092

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁)

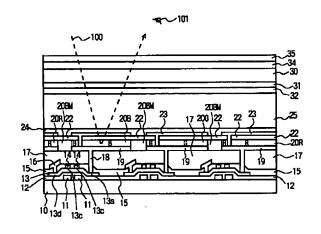
(21)出願番号	特顧平10-335873	(71)出顧人				
(22)出顧日	平成10年11月26日(1998.11.26)		三洋電機株式会社 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号			
(OD) [LIME [Maro 11/120 (10001 11/20)	(72)発明者	則武 和人			
			大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内			
		(72)発明者	小川(真司)			
			大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内			
		(74)代理人	100111383			
			弁理士 芝野 正雅			

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 カラー反射型液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 両基板を接着する際に、カラーフィルタの各色と各表示画素の位置ずれによる色ずれが発生しないカラー反射型液晶表示装置及びその製造方法を提供する。 【解決手段】 TFT基板10側に、各反射表示電極19上にカラーフィルタのそれぞれの色素層20R、20G、20Bを設け、その上に光拡散層22、及びこの光拡散層22と屈折率が等しい透明電極23を設ける。 反射表示電極19と透明電極23とはカラーフィルタ20及び光拡散層22に設けたコンタクトホールにて接続されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 互いに対向して配置された第1及び第2 の基板間に液晶を挟持しており、前記第1の基板には、 スイッチング素子、該スイッチング素子に接続された反 射表示電極、該反射表示電極上に設けた色素層及び光拡 散層、該光拡散層上に前記色素層及び光拡散層に設けた コンタクトホールを介して前記反射表示電極に接続して 成る透明電極を積層して備え、前記第2の基板には前記 反射表示電極に対向した対向電極を備えたことを特徴と するカラー反射型液晶表示装置。

1

【請求項2】 前記透明電極を構成する材料と前記光拡 散層の屈折率が等しいことを特徴とする請求項1に記載 のカラー反射型液晶表示装置。

【請求項3】 互いに対向して配置された第1及び第2 の基板間に液晶を挟持したカラー反射型液晶表示装置の 製造方法であって、

前記第1の基板上にスイッチング素子を形成する工程 と、該スイッチング素子を含む全面を覆った平坦化絶縁 膜を形成する工程と、該平坦化絶縁膜に設けたコンタク トホールを介して前記スイッチング素子に接続され前記 20 平坦化絶縁膜上に反射表示電極を形成する工程と、該反 射表示電極上に色素層及び光拡散層を形成する工程と、 該前記色素層及び光拡散層に設けたコンタクトホールを 介して前記反射表示電極と接続された透明電極を形成す る工程と、前記第2の基板上に前記反射表示電極に対向 した対向電極を形成する工程とを備えたことを特徴とす るカラー反射型液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、色素層及び光拡散 30 N)液晶21を挟持する。 層を備えたカラー反射型液晶表示装置及びその製造方法 に関する。

[0002]

【従来の技術】従来から、観察方向から入射した光を反 射させて表示を見るいわゆる反射型液晶表示装置が提案

【0003】図3に、従来の反射型液晶表示装置の断面 図を示す。

【0004】同図に示すように、従来の反射型液晶表示 装置は、石英ガラス、無アルカリガラス等からなるTF T10上に、スイッチング素子である薄膜トランジスタ (以下、「TFT」と称する。)を形成する。以下、こ のTFTを形成したTFT10をTFT基板と称する。 【0005】まず、TFT基板10上に、クロム(C r)、モリブデン(Mo)などの高融点金属からなるゲ ート電極11、ゲート絶縁膜12、及び多結晶シリコン 膜からなる能動層13を順に形成する。

【0006】その能動層13には、ゲート電極11上方 のチャネル13cと、このチャネル13cの両側に、チ ャネル13c上のストッパ絶縁膜14をマスクにしてイ 50 置を作製する際に、対向電極基板30上のカラーフィル

オン注入されて形成されるソース13s及びドレイン1 3dが設けられている。

【0007】そして、ゲート絶縁膜12、能動層13及 びストッパ絶縁膜14上の全面に、SiO₂膜、SiN 膜及びSi○2膜の順に積層された層間絶縁膜15を形 成し、ドレイン13dに対応して設けたコンタクトホー ルにアルミニウム (A1)等の金属を充填してドレイン 電極16を形成する。更に全面に例えば有機樹脂から成 り表面を平坦にする平坦化絶縁膜17を形成する。そし 10 て、その平坦化絶縁膜17のソース13sに対応した位 置にコンタクトホールを形成し、このコンタクトホール を介してソース13sとコンタクトしたアルミニウム (A1)から成りソース電極18を兼ねた反射電極であ る反射表示電極19を平坦化絶縁膜17上に形成する。 そしてその反射表示電極19上にポリイミド等の有機樹 脂からなり液晶21を配向させる配向膜20を形成す

【0008】また、TFT基板10に対向し、石英ガラ ス、無アルカリガラス等からなる絶縁性基板である対向 電極基板30には、TFT基板10側に、赤(R)、緑 (G)、青(B)の各色及び遮光機能を有するブラック マトリックス32を備えたカラーフィルタ31、その上 に形成された樹脂から成りカラーフィルタ31を保護す る保護膜33、その保護膜33の全面に形成された光拡 散層34、対向電極35及び配向膜36を備えており、 またその反対側の面には位相差板44及び偏光板45が 配置されている。そして、対向電極基板30とTFT基 板10の周辺をシール接着材(図示せず)により接着 し、形成された空隙にツイスティッドネマティック(T

【0009】外部から入射される自然光100は、実線 矢印で示すように、観察者101側の偏光板45から入 射し、位相差板44、対向電極基板30、カラーフィル タ31、保護膜33、光拡散層34に到達し、その光が この光拡散層34にて拡散され、その拡散された光は対 向電極35、配向膜36、TN液晶21、TFT基板1 0上の配向膜20を透過し、反射表示電極19にて反射 され、その後、入射と逆の方向に各層を透過して対向電 極基板30上の偏光板45から出射し観察者の目101 40 に入る。

【0010】このように、対向電極基板30の保護膜3 3上に光拡散層34を設けると、入射した光はこの光拡 散層34にて拡散される。そして、その拡散された光 は、多方向に進んで反射表示電極19によって反射され た後、観察者101の目に到達することになる。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】ところが、図3に示す ように、TFT基板10と対向電極基板30の周辺を接 着性シール材で接着して貼り合わせて反射型液晶表示装 タの各色とTFT基板10上の各表示画素とが位置ずれしないようにしなければならない。そのため両基板を貼り合わせるのに非常に時間を必要とすることになり、また位置ずれによる色にじみが発生するという欠点があった。

【0012】そこで本発明は、上記の従来の欠点に鑑みて為されたものであり、両基板を接着する際に精度の良い位置あわせが不要であり、色にじみがなく均一で明るい表示を得ることができるカラー反射型液晶表示装置及びその製造方法を提供することを目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明のカラー反射型液晶表示装置は、互いに対向して配置された第1及び第2の基板間に液晶を挟持しており、前記第1の基板にはスイッチング素子、該スイッチング素子に接続された反射表示電極、該反射表示電極上に色素層、光拡散層、及び前記反射表示電極に接続して成る透明電極を順に積層して備え、前記第2の基板には前記反射表示電極に対向した対向電極を備えたものである。

【0014】また、上述のカラー反射型液晶表示装置の 20 前記透明電極を構成する材料と前記光拡散層の屈折率が 等しいものである。

【0015】更に、互いに対向して配置された第1及び第2の基板間に液晶を挟持したカラー反射型液晶表示装置の製造方法であって、前記第1の基板上にスイッチング素子を形成する工程と、該スイッチング素子を含む全面を覆った平坦化絶縁膜を形成する工程と、該平坦化絶縁膜に設けたコンタクトホールを介して前記スイッチング素子に接続され前記平坦化絶縁膜上に反射表示電極を形成する工程と、該反射表示電極上に色素層及び光拡散 30層を形成する工程と、該光拡散層に設けたコンタクトホールを介して前記反射表示電極と接続された透明電極を形成する工程と、前記第2の基板上に前記反射表示電極に対向した対向電極を形成する工程とを備えたものである。

[0016]

【発明の実施の形態】本発明のカラー反射型液晶表示装置について、以下に説明する。

【0017】図1に本発明のカラー反射型液晶表示装置の断面図を示し、図2にTFT基板側の製造工程の断面 40 図を示す。

【0018】図1に示すように、本実施の形態の場合、一方のTFT基板10上にCr、Mo等の高融点金属からなるゲート電極11の形成から平坦化絶縁膜17の形成までは前述の構造と同じであるので説明を省略する。【0019】平坦化絶縁膜17上には、多結晶シリコン膜からなる能動層13のソース13sに接続されたA1、銀(Ag)等の導電性反射材料からなる反射表示電極19を形成する。またこの反射表示電極19上には、表(B)20B

色及び遮光機能を有するブラックマトリックス20BMを備えたカラーフィルタを形成する。その上には光を拡散する光拡散層22を全面に形成する。更にその上にはITO(Indium Thin Oxide)等の透明導電性材料からなり、光拡散層22及びカラーフィルタに設けたコンタクトホールを介して反射表示電極19にコンタクトしている透明電極23を形成する。

【0020】ここで、反射表示電極19上にカラーフィルタ20R、20G、20B及び光拡散層34に設けた10 コンタクトホールを介して透明電極23を設けるのは、反射表示電極19上に形成した光拡散層34で容量を持ってしまい、反射表示電極19に印加した本来液晶25に印加すべき電圧がドロップしてしまい、印加すべき電圧が液晶25に印加されなくなってしまうことを防止するためである。

【0021】また、透明電極23は、反射表示電極19とほぼ同じ大きさ若しくは反射表示電極19よりも大きく形成する。そうすることにより、液晶25に印加する電圧が充分液晶23に印加することができる。そして、透明電極23を含む全面にポリイミド等からなり液晶25を配向させる配向膜24を形成する。

【0022】他方の石英ガラス、無アルカリガラス等の 絶縁性基板からなる対向電極基板30は、液晶25を配 置する側には、各透明電極23に対向した対向電極31 が全面に設けられている。更にその全面にはポリイミド から成る配向膜32が形成されている。

【0023】また、対向電極基板30の液晶を配置しない側、即ち観察101側には、位相差($\lambda/4$)板34及び偏光板35が対向電極基板30側から順に設けられている。

【0024】こうして作製されたTFT基板10及び対向電極基板30の周辺を接着性シール材(図示せず)にて接着し、その接着によって形成された間隙に液晶25、例えばTN液晶を充填して液晶表示装置が完成する。

【0025】ここで、外部から入射した光の進み方について説明する。

【0026】外部から入射される自然光100は、図1中に点線矢印で示すように、観察者101側の偏光板35から入射し、位相差板34、対向電極基板30、対向電極31及び配向膜32、液晶25を透過して、TFT基板10上の配向膜24を透過して、透明電極23、光拡散層22に到達する。そして光が拡散され、拡散された光はカラーフィルタ20を透過して反射表示電極19に到達する。その到達した光は反射表示電極19によって反射される。反射した光は、入射と逆の光路をたどって位相差板34及び偏光板35を通過して観察者101に観察される。

極19を形成する。またこの反射表示電極19上には、 【0027】図2に従ってTFT基板の製造方法を説明 赤(R)20R、緑(G)20G、青(B)20Bの各 50 する。なお、図2(b)以降の工程図には平坦化絶縁膜

17を含む上層の断面のみを示す。

【0028】図2(a):石英ガラス、無アルカリガラ ス等からなるTFT基板10上に、スイッチング素子で あるTFTを形成する。

【0029】TFT基板10上に、クロム(Cr)、モ リブデン(Mo)などの高融点金属からなるゲート電極 11、ゲート絶縁膜12、及び多結晶シリコン膜からな る能動層13を順に形成する。

【0030】その能動層13には、ゲート電極11上方 ャネル13c上のストッパ絶縁膜14をマスクにしてイ オン注入されて形成されるソース13s及びドレイン1 3 dが設けられている。

【0031】そして、ゲート絶縁膜12、能動層13及 びストッパ絶縁膜14上の全面に、SiO₂膜、SiN 膜及びSiO2膜の順に積層された層間絶縁膜15を形 成し、ドレイン13dに対応して設けたコンタクトホー ルにアルミニウム(A1)等の金属を充填してドレイン 電極16を形成する。更に全面に例えば有機樹脂から成 り表面を平坦にする平坦化絶縁膜17を形成する。そし 20 て、その平坦化絶縁膜17にコンタクトホールを設け る。

【0032】図2(b):コンタクトホールを設けた平 坦化絶縁膜17上にA1、銀(Ag)等の導電性反射材 料を堆積し、ホトリソ技術により反射表示電極19を形 成する。

【0033】そして、その上に色素層であるカラーフィ ルタを形成する。まず赤色(R)の顔料を含有するレジ ストを全面にスピンナ等で塗布し、マスク26を用いて 露光を行う。

【0034】図2(c):マスクで覆った領域以外の赤 色の顔料及びマスクを除去することにより、赤色を呈す るカラーフィルタ20Rを反射表示電極19上に形成す

【0035】図2(d): 同様に、他のG、B及びブラ ックマトリクス32をそれぞれ緑、青及び黒色の顔料を 含有するレジストにマスクをして露光を行って順次形成 する。

【0036】図2(e):そして、カラーフィルタ20 の全面に光拡散層22をスピンナによって塗布する。光 40 拡散層22はアクリル樹脂を基体とし、その基体中にビ ーズ粒子を混入させたものであり、そうすることにより 入射した光を拡散するものである。本実施の形態の場 合、アクリル樹脂は屈折率が1.4~1.6のものを用 いた。そして、この光拡散層22にコンタクトホールを 設ける。このとき、同時にカラーフィルタも貫通して、 コンタクトホールを設け反射表示電極19にまで到達さ せる。

【0037】図2(f):その後、光拡散層22の全面 に屈折率が光拡散層22と等しい透明導電材料、例えば 50 光拡散層22及びカラーフィルタに入射し反射表示電極

ITOを堆積して反射表示電極19と概ね同じ面積ある いはやや大きい面積の透明電極23を形成する。その上 に、液晶25を配向する配向膜24を全面に形成する。 こうして、TFT基板10が完成する。上述の両基板1 0、30の周辺を接着性シール材にて接着して液晶表示 装置が完成する。その際、従来のカラー反射型液晶表示 装置であれば、TFT基板10上に設けた透明電極23 と、その透明電極23に対応した大きさの対向電極基板 30上の各色カラーフィルタとが位置ずれすることなく のチャネル13cと、このチャネル13cの両側に、チ 10 精度良く位置合わせをする必要があった。万一位置ずれ をすると隣接する色が混合されて色にじみが発生してい

> 【0038】ところが、本発明のカラー反射型液晶表示 装置によれば、各色のカラーフィルタが反射表示電極1 9上にパターン形成によって精度良く設けられているの で、両基板10,30の精度の高い位置合わせが不要と なり貼り合わせ工程の短縮化が図れるとともに、位置ず れによる色にじみ発生が防止できる。

【0039】また、光拡散層22を対向電極基板30上 に設けた場合には、入射した光の一部が光拡散層22に て後方に散乱されてしまい液晶25層に到達することな く観察者101側に出射してしまっていたが、光拡散層 22をTFT基板10上に設けているので、入射した光 は全てTFT基板10側に達した後、全て液晶25層を 通って観察者101側に出射することになる。従って、 観察者101側から入射しTFT基板10側の透明電極 23及び反射表示電極19に達した光は、全て液晶25 層によって透過又は遮断され表示に寄与することになる ため、効率よく光を利用することができ、それによって 30 均一で明るい表示を得ることができる。

【0040】更に、反射表示電極19上に光拡散層34 を設けることにより、その光拡散層34で容量を持つた め、反射表示電極19に印加した電圧がドロップしてし まい、本来液晶23に印加されるべき電圧が液晶25に 印加されない。そのため、それを防止するために、カラ ーフィルタ及び光拡散層34に設けたコンタクトホール を介して反射表示電極19と接続された透明電極23を 光拡散層34上に設ける。では液晶25に印加できない ため、光拡散層34上に透明電極23を設ける。即ち、 透明電極23は光拡散層34に設けたコンタクトホール を介して反射表示電極34と接続しているため、反射表 示電極19によって電圧を印加する際の電圧降下が生じ ることなく反射表示電極19に印加された電圧が印加さ れ、液晶25にその電圧が印加されることになる。

【0041】また、光拡散層22と透明電極23の屈折 率が等しいので、光拡散層22での光の反射が起こって カラーフィルタまで達しない光が発生することが防止で きる。即ち、図1の点線矢印で示すように、透明電極2 3に入射した光は光拡散層22にて反射することなく、

10

にて反射して、各画素の色を観察者によって観察することが可能となる。

[0042]

【発明の効果】本発明によれば、両基板の画素部の位置 合わせを精度良くすることが不要となり工程の簡略化が 図れるとともに、色にじみがなく均一で明るい表示を得 られる可能なカラー反射型液晶表示装置が得られる。

【図面の簡単な説明】

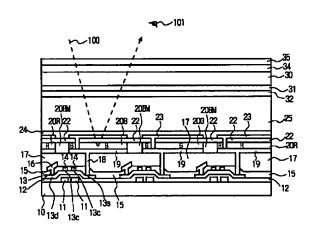
【図1】本発明のカラー反射型液晶表示装置の断面図である。

【図2】本発明のカラー反射型液晶表示装置の製造工程 断面図である。

【図3】従来のカラー反射型液晶表示装置の断面図である。

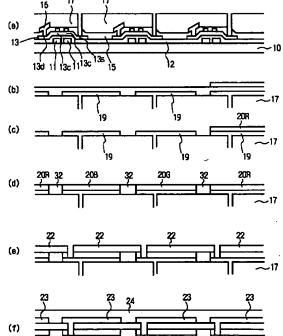
【符号の説明】

【図1】

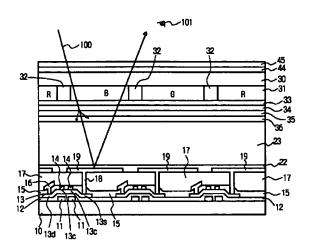


TFT基板 10 13 能動層 15 層間絶縁膜 17 平坦化絶縁膜 19 反射表示電極 20R カラーフィルタ 20B カラーフィルタ 20R. カラーフィルタ 22 光拡散層 23 透明電極 配向膜 24 25 液晶 30 対向電極基板 34 位相差板 35 偏光板

【図2】



【図3】



フロントページの続き

Fターム(参考) 2H091 FA02Y FA14Y FA31Y FC01 FD04 FD06 GA13 KA01 LA16 LA18

2H092 JA26 JA36 JA40 JA44 JA46 JB04 JB07 JB56 JB58 KA04 KA18 KB13 MA10 MA15 MA27 MA37 NA03 NA27 PA08 PA12